

유한요소법에 의한 자성재료의 전자구조가 자기저항에 미치는 영향 조사
 (Study on the Electronic Structure Effects of Ferromagnets on
 Magnetoresistance in terms of Finite Element Method)
 카이스트 신소재공학과 노은선*, 이혁모

1. 서론

스핀밸브와 자기터널소자 등에서 나타나는 자기저항을 보다 높이기 위한 방법 중 하나로 자성재료에 대한 많은 연구가 이루어져 왔다. 그 결과, 코발트가 페르로이보다 자기저항을 보다 크게 한다든가 페르로이를 (111) 방향으로 에피택시로 성장시킴으로써 자기저항을 두 배로 높인다든가 하는 등 현재까지 자성재료에 대한 최적조건이 어느 정도 결정된 상태이다. 그러나 실험결과에 대한 원인규명이 확실하지 않고 그에 따라 더 이상의 연구진척이 어려운 실정이다. 따라서 본 연구에서는 Circuit theory라는 유한요소법을 사용하여 자성재료의 방향성과 성분에 따른 자기저항과 스핀분극을 계산함으로써 자성재료의 전자구조가 어떻게 자기저항에 영향을 미치는지를 조사하였다.

2. 실험방법

시뮬레이션 대상은 [자성층120Å/Cu60Å/자성층]이라는 단순한 구조의 CPP 스판밸브이며 자성재료의 방향성이 자기저항에 미치는 영향을 알아보기 위해 자성재료를 polycrystalline NiFe, (111) textured NiFe, (100) textured NiFe로 설정하였고 자성재료의 성분이 자기저항에 미치는 영향을 알아보기 위해 자성재료를 Co와 NiFe로 설정하였다. Circuit theory는 두 개의 자성층 간의 자화방향(θ)에 따른 소자전체저항에 대한식을 제공하는 데 본 연구에서는 이식을 이용하여 자기저항을 계산하였으며 식은 다음과 같다.

$$\frac{e^2}{h} R(\theta) = \frac{2}{g} \frac{\left\{ \tan^2 \frac{\theta}{2} + \eta \right\}}{\left\{ (1 - p^2) \tan^2 \frac{\theta}{2} + \eta \right\}} \quad (g = G^\uparrow + G^\downarrow, \quad p = \frac{G^\uparrow - G^\downarrow}{G^\uparrow + G^\downarrow}, \quad \eta = \frac{2G^{\uparrow\downarrow}}{G^\uparrow + G^\downarrow})$$

$$G^\uparrow = \frac{e^2}{h} \sum_{nm} |t_{\uparrow}^{nm}|^2, \quad G^\downarrow = \frac{e^2}{h} \sum_{nm} |t_{\downarrow}^{nm}|^2, \quad G^{\uparrow\downarrow} = \frac{e^2}{h} \left[M - \sum_{nm} r_{\uparrow}^{nm} (r_{\downarrow}^{nm})^* \right]$$

위의식들을 계산하기 위해 기본적으로 필요한 것이 mode와 spin에 따른 transmission coefficient이며 본 연구에서는 Transfer matrix method에 의해 transmission coefficient를 결정하였고 식은 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} A^{l,+} \\ A^{l,-} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^{N-1} T(i, i+1) \begin{pmatrix} A^{N,+} \\ A^{N,-} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11}(l, N) & T_{12}(l, N) \\ T_{21}(l, N) & T_{22}(l, N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{N,+} \\ A^{N,-} \end{pmatrix}, \quad t = \frac{k^N}{k^l} \times \frac{1}{(T_{11}(l, N))^2}$$

위의식들을 계산하기 위해 기본적으로 필요한 것이 파동벡터이며 본 연구에서는 Effective mass approximation에서 제공하는 Hamiltonian을 사용하여 파동벡터를 계산하였다. 식은 다음과 같다.

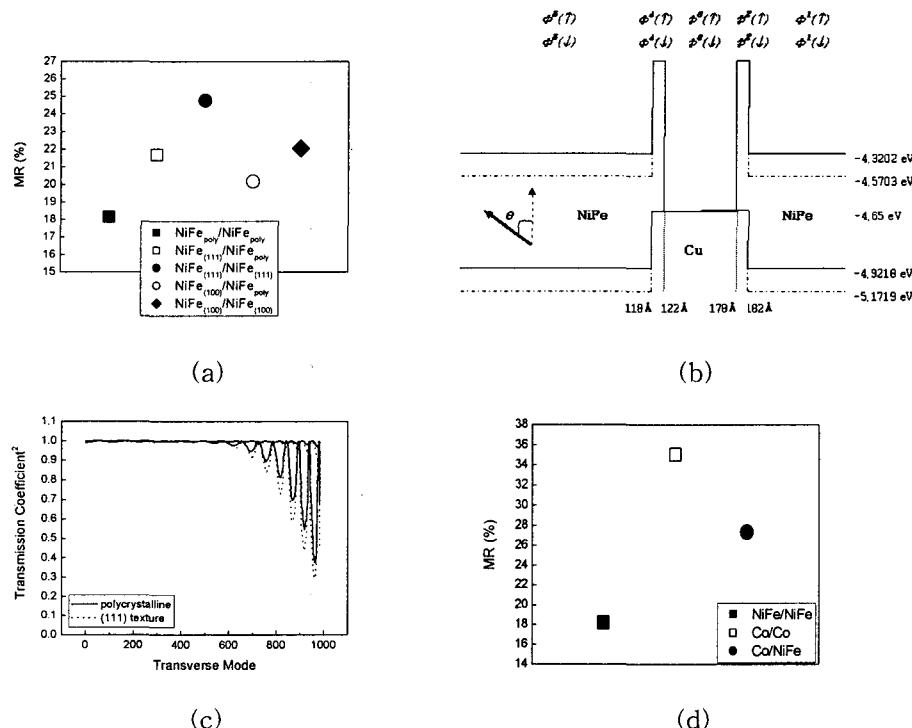
$$\left[\varepsilon_s + \frac{(i\eta\nabla_x + eA_x)^2}{2m} + U(x) \right] \Psi(x) = \varepsilon \Psi(x)$$

위의식을 계산하기 위해 평면파를 사용하였고 Cu의 ε_c 는 Work function으로 결정하였

고 자성재료의 ε_c 는 Stoner exchange parameter에 의해 결정하였고 계면에서의 Contact potential은 $|\varepsilon_c^{non-ferro} - \varepsilon_c^{ferro,\uparrow}|$ 으로 정의하였다. 자성재료의 ε_c 에 대한 식은 다음과 같다.

$$\varepsilon_c^\uparrow = \varepsilon_F - \frac{2\pi\eta^2}{m} \times n_s^\uparrow - \frac{1}{2} \times I, \quad \varepsilon_c^\downarrow = \varepsilon_F - \frac{2\pi\eta^2}{m} \times n_s^\downarrow + \frac{1}{2} \times I$$

3. 실험결과 및 고찰



그림(a)은 자성재료의 방향성에 따른 자기저항에 대한 결과로 이로부터 (111) textured NiFe가 가장 자기저항에 유리하다는 것을 알 수가 있다. 그림(b)와 그림(c)로부터 그 이유를 알 수가 있는데, 그림(b)에서 점선은 (111) textured NiFe에 대한 potential diagram이고 실선은 polycrystalline NiFe에 관한 것이다. Contact potential의 높이가 (111) textured NiFe의 경우가 polycrystalline NiFe의 경우보다 더 높은 것을 볼 수가 있고 이로 인해 그림(c)에서 mode가 높은 경우에 나타나는 dip의 깊이가 Contact potential이 더 높은 (111) textured NiFe의 경우에 더 깊게 나타나서 결국 스핀분극이 (111) textured NiFe의 경우에 더 크게 나타나게 되는 것이다. 자성재료의 방향성에 따른 Contact potential의 차이는 Work function의 차이로부터 비롯되었다. 이로부터 자성층과 Cu 층간의 계면에서의 전자구조가 자기저항에 중요한 영향을 미친다는 것을 알 수가 있다. 그림(d)는 자성재료의 성분에 따른 자기저항에 대한 결과로 이로부터 Co가 NiFe 보다 자기저항이 더 높다는 것을 알 수가 있다. 이는 Co의 Stoner exchange parameter가 NiFe 보다 더 높아서 그로 인해 Co와 Cu 간의 Contact potential이 더 높기 때문에 나타나는 현상이다.

4. 참고문헌

- [1] A. Brataas, Y. V. Nazarov and G. E. W. Bauer, Eur. Phys. J. B 22, 99 (2001)
- [2] J. F. Janak, Phys. Rev. B 16, 255 (1977)